

PMT orders maskless lithography system from EV Group for advanced memory wafer probe card manufacturing - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. "Fine-pitch probe card manufacturing involves many lithographic patterning steps, which can significantly drive up cost of ownership." stated Dr. Yong-Ho Cho, CEO of PMT. Incorporating EVG's MLE™ (maskless exposure) technology, LITHOSCALE addresses lithography needs for markets and applications that require a high degree of flexibility or product variation. LITHOSCALE tackles legacy bottlenecks by combining powerful digital processing that enables real-time data transfer and immediate exposure, high structuring resolution and throughput scalability.



http://www.mtime.co.kr/ press/?newsid=983108

EVG 한국자사의 유영식 지사장은 "피연티가 자사 제품 포트플리오를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 등게 돼 매우 기쁘다"며 "프로브 카드를 사용하는 웨이퍼 레멘 테스트는 디바이스 생신 수울을 높이고, 다이당 전반적 테스트 비용을 낮추기 위한 필수 공장이다. LITHOSCALE은 높은 분해능, 다양하고 많은 제품 설계를 처 제할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용 특성을 결합한 독창적인 솔루션으로, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카 드 제조용으로 매우 이상적"이라고 말했다.

EVG의 MLET/Maskless Exposure) 기술을 작용한 LITHOSCALE은 실수 존의 유연성이나 재목 다양성이 필요 한 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다. LITHOSCALE은 실사간 데이터 전송과 즉각적인 노광 를 가능하게 하는 강격한 디지털 프로세성 능격과 높은 구조적 본제는 및 정산 자리강 확강성을 권합하므로써 기존 리소그래비 방식의 병목 문제를 해결한다. EVG의 LITHOSCALE은 빠른 프로토타임 개발에 매우 이상적인 승구선으로, 턴더라운드 시간과 연구 개발 주기를 당당길 수 있게 해준다. MEMS 제조는 특히 미세공정의 복점성 때문에 공정 난도가 높으며, 그 결과 마스크 제조 비용 증가를 피할 수 없는 한계가 있다. 마스크를 사용하지 않는 LITHOSCALE은 높은 초점 신도와 교본에당(2m 수준의 LYStimes & Spaces) 성능을 보장함에 따라 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고델로 재백 선 레이어(RDL)와 비하산에 연결를 가능하게 해준다.